

AIXTRON erhält CS High-Volume Manufacturing Award

Fachmagazin zeichnet innovatives GaN-on-Si-Produktionssystem
AIX G5+ C mit renommiertem Branchenpreis aus

Herzogenrath, 04. März 2016 – AIXTRON SE (FSE: AIXA; NASDAQ: AIXG), ein weltweit führender Hersteller von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, hat für das neue voll automatisierte MOCVD-System AIX G5+ C bei der Verleihung der CS Industry Awards 2016 die Auszeichnung in der Kategorie „High-Volume Manufacturing“ erhalten. Die Preise für die Halbleiterindustrie werden auf Basis einer Umfrage innerhalb der Industrie für besonders innovative Lösungen bei der Herstellung von Halbleiter-Chips vergeben – angefangen von der Forschung bis hin zum fertigen Bauteil. Nominiert werden Personen, Prozesse und Produkte, die entscheidend zur Weiterentwicklung der Industrie beitragen.

„Es gibt zwei Möglichkeiten, um die Herstellungskosten zu senken: zum einen die Skalierung auf größere Wafer, zum anderen der Wechsel zu Siliziumsubstraten. Mit AIXTRON's jüngster Anlage stehen nun beide Optionen zur Verfügung“, kommentierten die Juroren von Compound Semiconductor die Entscheidung.

Dr. Frank Wischmeyer, Vice President Marketing & Business Development Power Electronics von AIXTRON, der den Preis im Rahmen der CS International-Konferenz in Brüssel entgegennahm, freute sich: „Die AIX G5+ C ist die erste vollständige MOCVD-Systemlösung, die die Produktionsanforderungen der Industrie an die Epitaxie für die Herstellung von GaN-auf-Silizium LED und Leistungsbauerelementen umsetzt. Durch die Kombination von zwei zentralen Innovationen in einem neuen Produkt, ermöglicht AIXTRON einen durchgängigen Produktionsablauf für LED oder Transistoren mit hoher Elektronenbeweglichkeit (HEMT) ohne Eingriff des Anlagenbedieners, aber mit dem Volumen der 150 mm oder 200 mm Batch-Systemarchitektur. Zum ersten Mal wurde hier eine industrielle Standardlösung für die Nutzung von MOCVD-Anlagen in Produktionslinien für silizium-basierte Logikbauelemente (CMOS) geschaffen, indem der MOCVD-Batchtechnologie die Automatisierung der Waferproduktion mittels eines Cassette-to-Cassette-Handlers hinzugefügt wurde.“

Die AIX G5+ C erleichtert die Handhabung und Verarbeitung von Siliziumwafern unter industriellen Bedingungen und ermöglicht eine Produktion mit höchster Ausbeute. Der von AIXTRON eigens für die Reaktorkammer entwickelte in-situ Reinigungsprozess erlaubt die vollständige Kontrolle der Reaktorbedingungen ohne die Notwendigkeit zur Reinigung von externen Teilen oder der Aufbereitung dieser Teile im MOCVD-Reaktor nach der Reinigung. Dieser Reinigungsprozess ist vollautomatisiert und macht damit jegliches manuelles oder automatisches Entfernen von Hardware-Komponenten aus der Reaktorkammer zu Reinigungs- oder Aufbereitungszwecken überflüssig.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL info@aixtron.de WEB www.aixtron.com

Die AIX G5+ C wurde durch die Industrie bereits erfolgreich für die Serienproduktion von GaN LED und leistungsstarken HEMT qualifiziert. Dabei demonstrierte die Anlage auch den erheblichen Anstieg bei Waferdurchsatz und Produktausbeute.

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT[®], AIXTRON[®], Atomic Level SolutionS[®], Close Coupled Showerhead[®], CRIUS[®], Gas Foil Rotation[®], Optacap[™], OVPD[®], Planetary Reactor[®], PVPD[®], TriJet[®]

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6; NASDAQ: AIXG, ISIN US0096061041) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere gegenwärtigen Beurteilungen und Annahmen wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen aufgeführt und bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL info@aixtron.de WEB www.aixtron.com